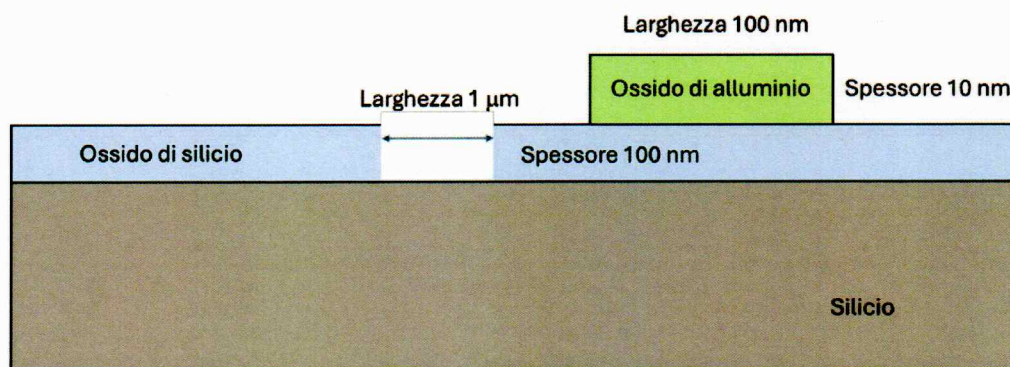


BANDO N. 1/2024/TD/CTER- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 36 (trentasei) mesi, di n. 2 unità di personale di VI livello, profilo professionale Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER)

TRACCIA N. 3

Si consideri la struttura rappresentata qui sotto in sezione. Le componenti della sezione NON sono in scala.

1. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica litografica che può essere utilizzata per ottenere la struttura dello strato in ossido di alluminio. Le dimensioni della struttura sono: larghezza 100 nm, lunghezza 100 nm (non mostrata in sezione).
2. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica di deposizione dello strato in ossido di alluminio che deve avere uno spessore di 10 nm.
3. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica di etching per ottenere la cava nell'ossido di silicio.
4. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica o le tecniche di caratterizzazione per verificare che la deposizione di ossido di alluminio abbia lo spessore desiderato.



Cg CF 182 l.h